

DERWENT-ACC-NO: 2001-660111
 DERWENT-WEEK: 200176
 COPYRIGHT 2011 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Information recording medium has phase-change-
 recording layer to which electron beam is
 irradiated for reproducing information based on variation of beam between crystal and amorphous phases

INVENTOR: MIURA H; OOTAKA K; WATADA A
 PATENT-ASSIGNEE: RICOH KK[RICO]
 PRIORITY-DATA: 2000JP-090524 (March 29, 2000)
 PATENT-FAMILY:
 PUB-NO
 PUB-DATE
 JP 2001273688 A
 October 5, 2001
 JA
 LANGUAGE

APPLICATION-DATA:
 PUB-NO
 APPL-DATE
 JP2001273688A
 N/A
 2000JP-090524
 March 29, 2000

INT-CL-CURRENT:
 TYPE IPC
 DATE
 CIPG G11B11/12 20060101
 CIPG G11B9/10 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 2001273688 A
 BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - An information recording medium (1) has phase-change-type recording layer (5) which generates a change of phase between a crystal phase and an amorphous phase, on a substrate (2). A record information is reproduced based on a strong variation of an electron beam between the crystal and amorphous

phases, when the electron beam is irradiated to the phase-change-type recording layer.

DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for information reproduction method.

USE - Information recording medium such as optical recording medium. ADVANTAGE - Enables to reproduce high density record information by detecting the strong variation of an electron beam between crystal and amorphous phases, when electron beam is irradiated to the phase-change-type recording layer.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a cross-sectional view of

information recording medium.

Information recording medium (1)

Substrate (2)

Phase-change-type recording layer (5)

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/11

TITLE-TERMS: INFORMATION RECORD MEDIUM PHASE CHANGE TYPE LAYER
ELECTRON BEAM

IRRADIATE REPRODUCE BASED VARIATION CRYSTAL AMORPHOUS

DERWENT-CLASS: T03

EPI-CODES: T03-D01A;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: 2001-492298

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-273688

(P2001-273688A)

(43) 公開日 平成13年10月5日 (2001.10.5)

識別記号

F I

7-71-1 (参考)

G I B 9/10

G I B 9/10

Z

11/12

11/12

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号

特願2000-90524(P2000-90524)

(71) 出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

三浦 博

(72) 発明者 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

和多田 篤行

(72) 発明者 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

大▲たか▼ かをり

(72) 発明者 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

代理人 100101177

(74) 代理人 井理士 柏木 慎史 (外 1 名)

(54) [発明の名称] 情報記録媒体及びその再生方法

(57) 【要約】

【課題】 高密度記録を実現するために電子線を用いて記録情報を再生するに適した媒体構成を持つ情報記録媒体を提供する。

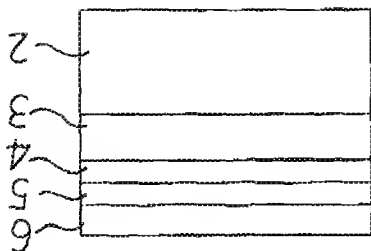
【解決手段】 少なくとも結晶相とアモルファス相との間で相変化を起こす相変化型記録層5を基板2上に有し、相変化型記録層5に対して電子線が照射された際に結晶相とアモルファス相との間で電子線の強度変化を呈することにより記録情報が再生される構成とする。通常

のレーザビームを用いた相変化記録では、ヘースが結晶相状態であり、アモルファス相状態にあり、このような情報記録媒体1に電子線を照射して観察する

と、アモルファス相状態にあるアモルファス相の結晶相に対して暗いコントラスト変化を示す。即ち、電子線の強度変化を呈する。従って、再生に際しては電子線を照射することによって、電子線の強度差を検出すること

記録情報の再生が可能となり、再生による制約を受けな

い高密度記録が可能となる。



生することが可能となり、再生による制約を受けない高密度記録が可能となる。

【0018】請求項2記載の発明は、請求項1記載の情報記録媒体が誘電体層を有する。請求項記載の発明

は、請求項1ないし4の何れかーに記載の情報記録媒体が導電層を有する。

【0019】従って、請求項2又は5記載の情報記録媒体の構成を採ることにより、電子線を利用して再生する

上で、耐環境性、信頼性に優れたより実用的な情報記録媒体となる。即ち、当該情報記録媒体は基板及び相変化

型記録層による単純2層構成に加えて、誘電体層と導電

層とのうち少なくとも1つの層を含んで構成される。例

えば、

基板/導電層/第1誘電体層/相変化型記録層/第2誘電

体層、

基板/導電層/相変化型記録層/誘電体層、

基板/誘電層/誘電体層/相変化型記録層、

基板/第1誘電体層/相変化型記録層/第2誘電体層、

基板/誘電層/誘電体層/相変化型記録層、

基板/導電層/相変化型記録層/誘電体層、

基板/誘電層/相変化型記録層/誘電体層、

基板/導電層/第1誘電体層/相変化型記録層/第2誘電

体層、

基板/誘電層/相変化型記録層/誘電体層、

基板/導電層/相変化型記録層/誘電層、

基板/相変化型記録層/導電層、

の如く積層構成とすることができ、ここで、基板とし

ては、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ポリオレフィ

ン、エポキシ樹脂、ビニルエスチル、紫外線硬化樹脂、

ガラス等の透明基板が使用できる。誘電体層としては、

SiO_2 、 Al_2O_3 、 Ta_2O_5 、 ZrO_2 、 ZnO などの

酸化物、 ZnS 、 SmS 、 SrS 、 GaS などの硫化

物、 CaF_2 、 MgF_2 、 BaF_2 、 SrF_2 などのフッ化

物、 BN 、 SiN などの窒化物、 SiC 、 DLC 、 i

-C等の炭化材料を、単体若しくは混合体として用い

ることができ、さらにこれらの材料は単層で用いても

よく、複数を積層構造として用いてもよい。

【0020】請求項3記載の発明は、請求項2記載の情報

記録媒体の前記誘電体層は、前記相変化型記録層と電

子線を照射する電子線源との間に配置されて、その膜厚

が50nm以下である。

【0021】請求項2又は5記載の発明による情報記録

媒体の各種層構成のうちで、記録時のレーザービームの照

射による熱ダメージや保存環境下での相変化型記録層の

変質を防止するためには、相変化型記録層表面が誘電体

層で被覆された層構成が特に好ましい。つまり、各種層

構成のなかで、

基板/導電層/第1誘電体層/相変化型記録層/第2誘電

体層、

基板/導電層/相変化型記録層/誘電体層、

基板/第1誘電体層/相変化型記録層/第2誘電体層、

基板/相変化型記録層/誘電体層、

の4種類がより実用的な層構成といえる。これらの層構

するに適した情報記録媒体構造等については、また、詳

細には言及されておらず、現実には高密度記録を実現する

上では検討の余地が多分にある。

【0007】そこで、本発明は、高密度記録を実現する

ために電子線を用いて記録情報を再生するに適した媒体

構成を持つ情報記録媒体及びその再生方法を提供するこ

とを目的とする。

【0008】加えて、電子線で記録情報を再生する上で

耐環境性、信頼性に優れた構成の情報記録媒体を提供す

る。

【0009】また、電子線入射側に配置させる誘電体層

の膜厚を最適化することにより、再生信号のS/N比を

向上させ得る情報記録媒体を提供する。

【0010】また、電子線入射側に位置させる誘電体層

の処理方法を最適化することにより、記録時のダメージ

を無くし、かつ、再生信号のS/N比を向上させ得る情

報記録媒体を提供する。

【0011】また、媒体表面を平坦化させることによっ

て、再生信号のS/N比を向上させ得る情報記録媒体を

提供する。

【0012】また、相変化型記録層の材料を最適化する

ことにより、再生信号のS/N比を向上させ得る情報記

録媒体を提供する。

【0013】また、導電性基板を用いることによって、

電子線で再生する際に問題となる表面のチャージアップ

を抑制し、再生信号のS/N比を向上させ得る情報記録

媒体を提供する。

【0014】また、相変化型記録層と導電層又は導電性

の基板とを接触させることによって、チャージアップを

抑制し、再生信号のS/N比を向上させ得る情報記録媒

体を提供する。

【0015】さらに、再生に際して電子線を照射する電

子線源のトラッキング可能な情報記録媒体及びその再

生方法を提供する。

【0016】

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明の情

報記録媒体は、少なくとも結晶相とアモルファス相との

間で相変化を起こす相変化型記録層を基板上に有し、前

記相変化型記録層に対して電子線が照射された際に前記

結晶相と前記アモルファス相との間で電子線の強度変化

を呈することにより記録情報が再生される。

【0017】通常のレーザービームを用いた相変化記録で

は、ペーアが結晶相状態であり、アモルファス相状態に

モルファス相状態にあるアモルファスの結晶相に対し

て弱いコントラスト変化を示す。即ち、電子線の強度変

化を呈する。従って、基板上に相変化型記録層を設けた

媒体構成とし、再生に際しては電子線を照射することに

よって、電子線の強度差を検出することによって記録情報を再

$y=1\sim4$ の組成比とした共晶組成を主成分とする記録

層材料を用いることが好ましい。このような組成では、アモルファスアークと結晶相領域との境界が明瞭に表れ

ることから、微小なアークにおいても鮮明な相変化コン

トラストが表れる。また、このような組成の相変化材料

は、積層する誘電体層との相互反応が起り難い。その

ために、請求項4記載の発明の如く誘電体層を除去した

状態においても、鮮明な相変化コントラストが得られ

る。共晶組成のSbTeを主成分とする相変化材料とし

てはAgInSbTeが挙げられるが、このような組成

に限らずB, Al, Si, Ga, Ge, Ag, In, Sn, Ba, La, Au, Bi, Cdの群から選ばれる少

なくとも1種類の元素を用いて、組成を最適化すること

によって鮮明な相変化アークコントラストが表れる。

【0028】請求項8記載の発明は、請求項1ないし7

の何れか一に記載の情報記録媒体の前記基板は、電気抵

抗が $1\times10^{-7}\sim100\Omega\cdot\text{cm}$ の範囲にある導電性材

料よりなる。

【0029】電子線により相変化アークを再生する場

合、媒体表面のチャージアークが問題になる。チャージ

アークが表面の凹凸と同様にノイズ成分となる。基板が

絶縁物であり、相変化型記録層がフローチャージ状態に

なるとチャージアークが発生する。この点、本発明のよ

うに基板として導電性基板を用いることによって、チャ

ージアークが低減できる。導電性基板としては、Alや

Al-Mgなどのアルミニウム合金、Si, Ge, Ga

Asなどの半導体材料が使用できる。基板の電気抵抗は

$1\times10^{-7}\sim100\Omega\cdot\text{cm}$ の範囲、好ましくは $1\times10^{-7}\sim1\times10^{-5}\Omega\cdot\text{cm}$ の範囲がよい。このような電

気抵抗値は、各層が積層されている反対側、つまり基板

表面において2端子若しくは4端子抵抗測定によってシ

ート抵抗を求め、基板厚みから換算した値でも構わな

い。

【0030】請求項9記載の発明は、請求項1ないし8

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0031】即ち、絶縁性基板を用いる場合には、導電

層と相変化型記録層との間、導電性基板を用いる場合に

は基板の金属層部分と相変化型記録層との間を接触させ

る。接触部分は、記録領域から外れた少なくとも媒体の

一部分に形成する。このような導通構造を採ることによ

り、さらに、チャージアークを抑制できる。

【0032】請求項10記載の発明は、請求項1ないし

9の何れか一に記載の情報記録媒体は、前記基板表面に

一定周期の凹凸形状を有し、電子線が照射された際に前

記凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を呈す

ることにより電子線源のトラッキング、アトラス又は同

期信号源に用いられる。

【0033】即ち、基板は表面にアトラス（トラッ

ク）信号源に用いられる。

【0034】請求項11記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0035】請求項12記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0036】請求項13記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0037】請求項14記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0038】請求項15記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0039】請求項16記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0040】請求項17記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0041】請求項18記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0042】請求項19記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0043】請求項20記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0044】請求項21記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0045】請求項22記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0046】請求項23記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0047】請求項24記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0048】請求項25記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0049】請求項26記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0050】請求項27記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0051】請求項28記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0052】請求項29記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0053】請求項30記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0054】請求項31記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0055】請求項32記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0056】請求項33記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0057】請求項34記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0058】請求項35記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0059】請求項36記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0060】請求項37記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0061】請求項38記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0062】請求項39記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0063】請求項40記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0064】請求項41記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0065】請求項42記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0066】請求項43記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0067】請求項44記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0068】請求項45記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0069】請求項46記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0070】請求項47記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0071】請求項48記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0072】請求項49記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0073】請求項50記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0074】請求項51記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0075】請求項52記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0076】請求項53記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0077】請求項54記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0078】請求項55記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0079】請求項56記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0080】請求項57記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0081】請求項58記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触している。

【0082】請求項59記載の発明は、請求項1ないし10

の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化型記録層

は、前記基板又は前記導電層と媒体面内における少なく

とも一部分で導電的に接触

深さが40nm、ピッチが0.7μmのプリグルーブが存在し(図示せず)、基板厚は0.6mm、基板径120mmの円盤状ディスクとされている。このような基板2上形成された導電層3としてはAgが用いられ、膜厚が120nmとされている。この導電層3上に形成された第1誘電体層4としてはZnS、SiO₂が用いられ、膜厚が20nmとされている。第1誘電体層4上に形成された相変化型記録層5としてはAgInSbTeが用いられ、膜厚が15nmとされている。この相変化型記録層5層上に形成された第2誘電体層6としてはZnS、SiO₂が用いられ、膜厚が20nmとされている。ここで、導電層3用のAg薄膜はDCスパッタ法で成膜し、その他の薄膜はRFスパッタ法で成膜する。【0040】図2に記録マークの電子線再生結果を示す。図1に示した層構成の情報記録媒体1に対して、波長635nm、開口数NA0.6の光学系を用いて相交変マークを記録した。ここではテューナ150%の単周期マークを記録しており、条件によって情報記録媒体1のクエンタル方向のマーク長を0.1〜0.4μmの範囲で変えた。図2(a)は電子線強度のプロファイルであり、プリグルーブされたランに沿った方向の強度プロファイルを示している。結晶レベルで電子線強度が強く、アモルファスレベルで電子線強度が弱くなっている。結晶レベルの電子線強度から50%低下した強度におけるマーク長を図2に示している。記録に用いたレーザービームは波長635nm、開口数NA0.6であり、ビーム径は約0.9μm(1/e²)である。このような記録時と同じ光学系をそのまま用いてレーザービームにより相交変マークを再生した場合、マーク間干渉によってマーク長0.3μm(マークピッチ0.6μm)以下は全く再生できなかったものである。これに対して、このような情報記録媒体1に電子線源により電子線を照射して記録情報(相交変マーク)を再生した場合、図2(b)に示すように、最小のマーク長0.1μmまで再生できていることが分かる。

【0041】即ち、通常のレーザービームを用いた相交変記録では、ベアが結晶相状態であり、マークがアモルファス相状態にある。このような情報記録媒体を走査型電子顕微鏡(SEM)により電子線を照射して観察すると、アモルファス相状態にあるマークがベアスの結晶相に対して暗いコントラスト変化を示す。即ち、電子線の強度変化を呈する。従って、基板2上に相変化型記録層を設けた媒体構成とし、再生に際しては電子線を照射することによって、電子線の強度差を検出することによって、再生情報を再生することが可能となり、レーザービームの再生限界以下のマーク長も十分に再生できることから、再生による制約を受けない高密度記録が可能となる。

【0042】本発明の第二の実施の形態を図3に基づいて説明する。第一の実施の形態で示した部分と同一部分は同一符号を用いて示し、説明も省略する(以降の各実施

形態内溝)や、プリピット(凹凸の孔)など一定周期で周期的な凹凸形状を有する構造とする。これにより、レーザービームによる記録の際には、凹凸形状による反射光強度の変化を検出して、レーザービーム源のトラッキング、アトリス、同期信号源とする。一方、電子線で再生する際には、凹凸形状のエッジ部分での急峻な電子線強度変化を呈することを利用して電子線の強度変化を検出することと、電子線源のトラッキング、アトリス、同期信号源とする。凹凸形状がプリグルーブである場合には、グルーブ深さは10〜500nm、好ましくは30〜50nmとする。グルーブピッチは0.1〜10μm、好ましくは0.3〜1μmとする。

【0034】請求項1記載の発明の情報記録媒体の再生方法は、請求項1ないし10の何れかーに記載の情報記録媒体を用い、電子線を利用して再生を行うことで、電子線はレーザービームよりも空間分解能が高いため、微小マークの再生が可能となり、レーザービームでは再生限界にある微小な相交変マークであっても再生でき、結果として、再生による制約を緩和させて情報記録媒体の記憶容量を大幅に増加させることができる。

【0036】請求項12記載の発明の情報記録媒体の再生方法は、請求項10に記載の情報記録媒体に対して電子線を偏向走査させながら照射し、この電子線を偏向走査させた際に呈される前記凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を検出し、再生時の電子線源のトラッキング、アトリス又は同期信号源に用いるようにした。【0037】従って、基板表面に一定周期の凹凸形状を有し、電子線が照射された際に凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を呈する請求項10記載の情報記録媒体を用い、電子線を偏向走査させた際に呈される凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を検出し、再生時の電子線源のトラッキング、アトリス又は同期信号源に用いるようにした。【0037】従って、基板表面に一定周期の凹凸形状を有し、電子線が照射された際に凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を呈する請求項10記載の情報記録媒体を用い、電子線を偏向走査させた際に呈される凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を検出し、再生時の電子線源のトラッキング、アトリス又は同期信号源に用いるようにした。【0038】

【発明の実施の形態】本発明の第一の実施の形態を図1及び図2に基づいて説明する。図1に本実施の形態の情報記録媒体1の層構成例を示す。この例では、情報記録媒体1は基板2/導電層3/第1誘電体層4/相変化型記録層5/第2誘電体層6の積層構造からなる。

【0039】基板2は例えばポリカーボネート基板なる絶縁性基板とされている。この基板2の表面にはグルー

前に沿ってコントラスト変化が見られる。従って、基本的に、通常の相変化記録では、ペーカが結晶状態である。

記録媒体1をSEM観察すると、アモルファス状態であり、このような情報、アークからアモルファス状態に対して暗いコントラスト変化を示すことから、基板2上に相変化した記録層5を設けた媒体構成とすることによって、電子線の強度差を検出することと記録情報を再生することが可能といえる。

【0049】ここに、図5(a)は導電層3をA1T1とした場合、図5(b)は導電層3を第一の実施の形態通りにA₂とした場合のSEM像を対比させて示している。何れの場合も導電層3の膜厚は120nmである。導電層3をA1T1材料とした媒体では、表面凹凸が強調され相変態コントラストが不鮮明である。これに対して、導電層3をA₂材料とした媒体では、情報記録媒体1の表面が平坦化でき、相変態コントラスト強度が増加している。電子線を試料(情報記録媒体1)表面に照射すると、二次電子や反射電子が放出される。特に二次電子の強度は表面形状によって敏感に変化する。相変態コントラストを再生する場合、表面に凹凸が存在する

【004】本発明の第三の実施の形態を図4に基づいて説明する。本実施の形態では、基本的には、図1に示した層構成の情報記録媒体1が用いられているが、記録時と記録後の再生時とはその層構成が異なるものとされている。

る。

10451 冊、図4(a)は記録時の情報記録媒体1の層構成を示し、図4(b)は再生時の情報記録媒体1の層構成を示している。レーザーで記録する際には(記録時)、図4(a)に示すように、相変位型記録層5の変形を防止するためにZnS、SiO₂による第2誘電体層6がある状態とする。一方、電子線で再生する際には(再生時)、図4(b)に示すように、ZnS、SiO₂による第2誘電体層6が無い状態とする。ZnS、SiO₂による第2誘電体層6の除去は、ウェットエッチングの手法で行う。フッ酸溶液と塩酸溶液を用いることによって、相変位型記録層5であるAlnSbTeにダメージを与えないことなく、ZnS、SiO₂のみを除去することができる。図4(b)に示すように第2誘電体層6の膜厚を薄く(ここでは0nm、つまり誘電体を除去)すること、図3に示した特性からも分かるように変調度が最大になり、S/N比が大きくなる。

10461 本実験の形跡の報告、一旦記録されては第2誘電体層が除去されてしまうので、書換え型には適していないが、情報記録媒体の製造工程においてサビームにより記録したマーク形成を観察する場合に適用的である。

【10041】本発明の第四の実施の形態を図1に示す。図1に示した層構成の情報を記録媒体1が用いられている。

100481 図らはこのような情報記録媒体 1 の相対比
マークを走査型電子顕微鏡により観察した SEM 像を示
している。このような SEM 像において、表面の周期的
な凹凸は基版 2 に形成されたマシクルーアであり、マシ

スク半径方向の断面の電子線強度プロファイルを示している。図10(b)は媒体表面のフリッグローブの断面形状を示しており、21はランプ部分、22はフリッグローブ部分を示している。

【0058】図5に示したSEM像からも分かるように、ランプ・フリッグローブ面の電子線強度はほぼ一定強度となるが、ランプ21のエッジ部分21eで電子線強度が極端に増加する。これは、2次電子のエッジ効果によるものである。本実施の形態では、この様な凹凸形状のランプ21のエッジ部分21eにおける電子線強度の急峻な増加を電子線を照射するための電子線源(図示せず)のトラッキンフ、フレックス又は同期信号源に利用するものである。

【0059】図11を参照して電子線源のトラッキンフ方法を説明する。図11(a)は、情報記録媒体1に対する電子線の走査方法を示している。23は電子線の軌跡を示している。24は電子線の偏向走査装置である。25は電子線検出器である。偏向走査装置24は対向電極26a、26bと信号源26とで構成され、一方の電極26aがフリップレベル、他方の電極26bが信号源27に接続され、信号源27に交流信号を印加することによって、電子線を一軸方向(X方向)に偏向走査する。

【0060】図11(b)は情報記録媒体1の平面図である。図11(a)に示した凹凸状の断面形状に対応し、22がフリッグローブ、21がランプである。28は情報記録媒体1の回転方向を示し、29はランプ21上の電子線の軌跡を示している。電子線を偏向走査装置24によってX方向に偏向走査させながら、情報記録媒体1を回転方向27に回転させることによって、電子線は軌跡29を描く。

【0061】図11(c)は、トラッキンフ方法の説明図である。30は偏向走査装置24の信号源27に対する入力信号である。31は電子線検出器25で検出される検出信号である。図10に示したように、ランプ21のエッジ部分21eで信号強度が急峻に増加することから、検出信号31は周期的にピークを持つプロファイルとなる。よって、図11(b)のように電子線がランプ21上に正確にトラッキンフできていれば、検出される検出信号31のピーク31pと、交流信号のピーク30pとは、常に一致する。従って、偏向走査装置(24)への入力信号の電圧、周波数を制御し、交流信号30と検出信号31のピークとが一致するようにサーボをかけることによって、電子線のランプ21上へのトラッキンフが可能となる。

【0062】

【発明の効果】請求項1記載の発明の情報記録媒体によれば、少なくとも結晶相とアモルファス相との間で相変化を起こす相変化型記録層を基板上に有し、前記相変化型記録層に対して電子線が照射された際に前記結晶相と

に迷がすことができ、S/N比が大きくなる。

【0052】本発明の第六の実施の形態を図8及び図9に基づいて説明する。本実施の形態は、ポリカーボネート基板のような絶縁性基板を基板12として用いた場合において、電子線を利用して再生する上でチャージフックを抑制し得る構成に関する。

【0053】図8(a)は本実施の形態の情報記録媒体11の平面図を示す。フリスク状の情報記録媒体11に關して、Aはフリスク中心、Bは最外面を示している。図8(b)はこのような情報記録媒体11のA-B線断面構造を示している。ポリカーボネート基板による基板12上にはAが薄膜による導電層13が設けられ、この導電層13上にはZnS、SiO₂による誘電体層14が設けられ、この誘電体層14上にはAgInSbTeによる相変化型記録層15が設けられている。ここに、この相変化型記録層15は情報記録媒体11の記録領域を避けたフリスク中心A側の最内周部分15aと最外周部分15bとで導電層13に直接接触して導通する構造が採られている。

【0054】これにより、導電性のA1基板を用いた第五の実施の形態の場合と同様に、電子線で相変化フックを再生した場合、相変化型記録層5の表面が帯電しても、その帯電電荷を導通している導電層13に逃がすことができる。S/N比が大きくなる。

【0055】図9はこのような部分的な接触構造を採る情報記録媒体11の製造方法を示す平面図である。11は上述した情報記録媒体である。16、17はスパッタリング工程で、情報記録媒体11を保持する内周ホルダ、外周ホルダである。図8(b)に示した層構成において、ZnS、SiO₂による誘電体層14の成膜用のホルダ16、17の大きさを、他の薄膜の成膜用のホルダの場合と変える。内周ホルダ16の外径Raを他よりも大きくし、外周ホルダ17の内径Rbを小さくする。このような成膜方法によって、ZnS、SiO₂による誘電体層14の成膜時に、最内周部分と最外周部分がマスキされ、その部分に相変化型記録層15の最内周部分15aと最外周部分15bとを積層させて導電層13に導通させる層構成とすることができる。

【0056】本発明の第七の実施の形態を図5、図10及び図11に基づいて説明する。本実施の形態は、電子線を利用した再生動作における電子線源のトラッキンフ等に関する。

【0057】本実施の形態では、図5のSEM像に示したように、情報記録媒体1の基板2に一定周期の凹凸形状をなすフリッグローブを設けることを基本とする。図10(a)では、図5(b)に示したSEM像におけるフリッグローブを横切る方向(トラックを横切る方向=フリス

抵抗が $1 \times 10^{-7} \sim 100 \Omega \cdot \text{cm}$ の範囲にある導電性材料よりなるので、電子線により相変化する再生する場面に問題となる媒体表面のチャージアップをこの導電性基板によって低減させることができる。

【0069】請求項9記載の発明によれば、請求項1ないし8の何れか一に記載の情報記録媒体は、絶縁性基板を用いる場合には、導電層と相変化した型記録層との間、導電性基板を用いる場合には基板の金属層部分と相変化した型記録層との間を接触させているので、さらに、チャージアップを抑制することができる。

【0070】請求項10記載の発明によれば、請求項1ないし9の何れか一に記載の情報記録媒体は、基板表面に一定周期の凹凸形状を有し、電子線が照射された際に凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を呈することにより電子線源のトラッキング、アドレス又は同期信号源に用いられるようにしたので、電子線で再生する際には、凹凸形状のエッジ部分での急峻な電子線強度変化を呈することを利用して電子線の強度変化を検出すること、電子線源のトラッキング、アドレス、同期信号源とすることができる。

【0071】請求項11記載の発明の情報記録媒体の再生方法によれば、請求項1ないし10の何れか一に記載の情報記録媒体を用い、電子線を利用して再生を行うことで、電子線はレーザビームよりも空間分解能が高いことから、微小マークの再生が可能となり、レーザビームでは再生限界にあたる微小な相変化するマークであっても再生でき、結果として、再生による制約を緩和させて情報記録媒体の記憶容量を大幅に増加させることができる。

【0072】請求項12記載の発明の情報記録媒体の再生方法によれば、基板表面に一定周期の凹凸形状を有し、電子線が照射された際に凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を呈する請求項10記載の情報記録媒体を用い、電子線を偏角走査させた際に呈される凹凸形状のエッジ部分で急峻な電子線強度変化を検出し、再生の際に電子線のトラッキング、アドレス又は同期信号源に用いられるようにしたので、再生の際に電子線のトラッキングが可能となり、再生の位置精度を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第一の実施の形態を示す情報記録媒体の断面構造図である。
【図2】電子線強度プロファイル及び電子線で再生した相変化するマーク長を示す説明図である。
【図3】本発明の第二の実施の形態の電子線強度プロファイル及び第二誘電体層膜厚による変動度の変化の様子を示す説明図である。

【図4】本発明の第三の実施の形態を示し、(a)は情報記録媒体の記録時の断面構造図、(b)は情報記録媒体の再生時の断面構造図である。
【図5】本発明の第四の実施の形態を示し、(a)は導

前記アモルファス相との間で電子線の強度変化を呈する

ことにより記録情報が再生される構成としたので、再生の際には電子線を照射することによって、電子線の強度差を検出することによって記録情報を再生することが可能となり、レーザビームでは再生限界にあたる微小な相変化するマークであっても再生でき、よって、再生による制約を受けない高密度記録を可能にすることができる。

【0063】請求項2記載の発明によれば、請求項1記載の情報記録媒体が誘電体層を有し、請求項5記載の発明によれば、請求項1ないし4の何れか一に記載の情報記録媒体が導電層を有するので、電子線を利用して再生動作を撮うことができない。

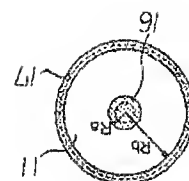
【0064】請求項3記載の発明によれば、請求項2記載の情報記録媒体において、誘電体層を備えることで記録時のレーザビーム照射による熱ダメージや保存環境下での相変化した型記録層の変質を防止することができる、かつ、その膜厚を 50 nm 以下としているので、電子線を利用した再生動作を撮うことができない。

【0065】請求項4記載の発明によれば、請求項3記載の情報記録媒体の前記誘電体層は、当該媒体の再生時にはその記録時の膜厚よりも薄くされているので、記録時のレーザビームによる熱ダメージや保存環境下での相変化した型記録層の変質を回避しつつ、電子線を利用した再生動作における再生信号のS/N比を向上させることができる。

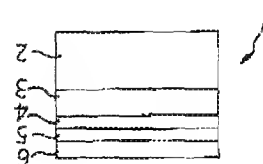
【0066】請求項6記載の発明によれば、請求項5記載の情報記録媒体の導電層が、Ag、Pd、Rh、Ta、W、Au、Pt、Ir、Os、In、Ti、Cu、Fe群から選ばれる少なくとも1種類の元素を含有するF θ 群から選ばれる少なくとも1種類の元素を含有するので、薄膜化した場合に平坦面を形成しやすく、このように導電層を最下層に配置させ、平坦な導電層とすることで情報記録媒体の最表面も平坦化でき、よって、S/N比が向上する等、耐環境性、信頼性の向上を図ることができる。

【0067】請求項7記載の発明によれば、請求項1ないし6の何れか一に記載の情報記録媒体の相変化した型記録層は、 $x/y=1 \sim 4$ の範囲にあるSb、Te、なる共晶組成を主成分とし、かつ、添加元素としてB、Al、Si、Ga、Ge、Ag、In、Sn、Ba、La、Au、Bi、Gdの群から選ばれる少なくとも1種類の元素を含有する相変化した材料からなるので、アモルファス相と結晶相領域との境界が明瞭に表れることから、マークと結晶相領域との境界が明瞭に表れることから、微小なマークにおいても鮮明な相変化したコントラストが表れる上に、このような組成の相変化した材料は、積層する誘電体層との相互反応が起こり難いために、請求項4記載の発明の如く誘電体層を除去した状態においても、鮮明な相変化したコントラストを得ることができる。

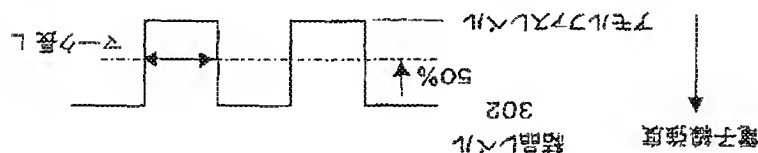
【0068】請求項8記載の発明によれば、請求項1ないし7の何れか一に記載の情報記録媒体の基板は、電気



【図9】

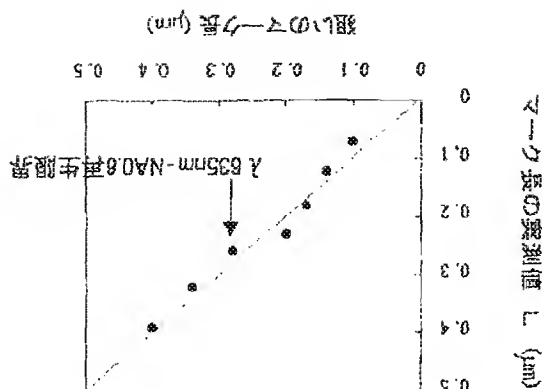


【図11】



(a) 電子線強度プロファイル

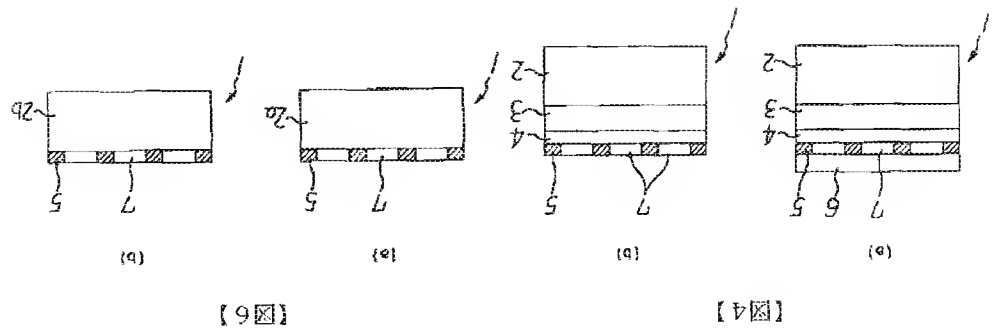
【図2】



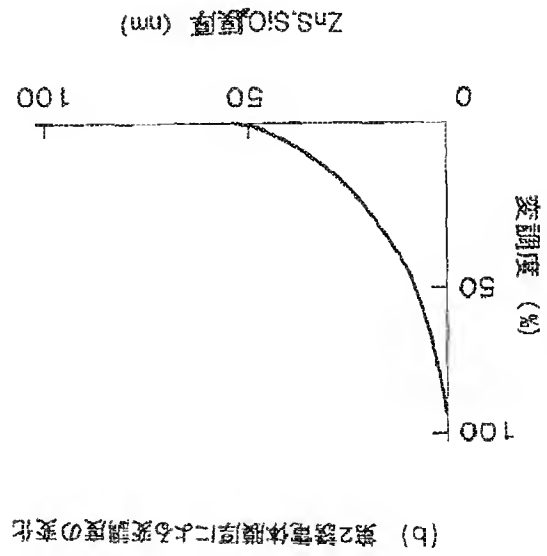
(b) 電子線で再生した相変化マーク長

電圧にA1T1を用いた場合の情報記録媒体のSEM像、(b)は導電層にA2を用いた場合の情報記録媒体のSEM像である。
【図6】本発明の第五の実施の形態を示し、(a)は基板にポリカーボネート基板を用いた場合の情報記録媒体の断面構造図、(b)は基板にA1基板を用いた場合の情報記録媒体の断面構造図である。
【図7】その電子線強度プロファイルを示す説明図である。
【図8】本発明の第六の実施の形態を示し、(a)は情報記録媒体の平面図、(b)はそのA-B線断面図である。
【図9】その製造方法を示す情報記録媒体の平面図である。
【図10】本発明の第七の実施の形態を示し、(a)は

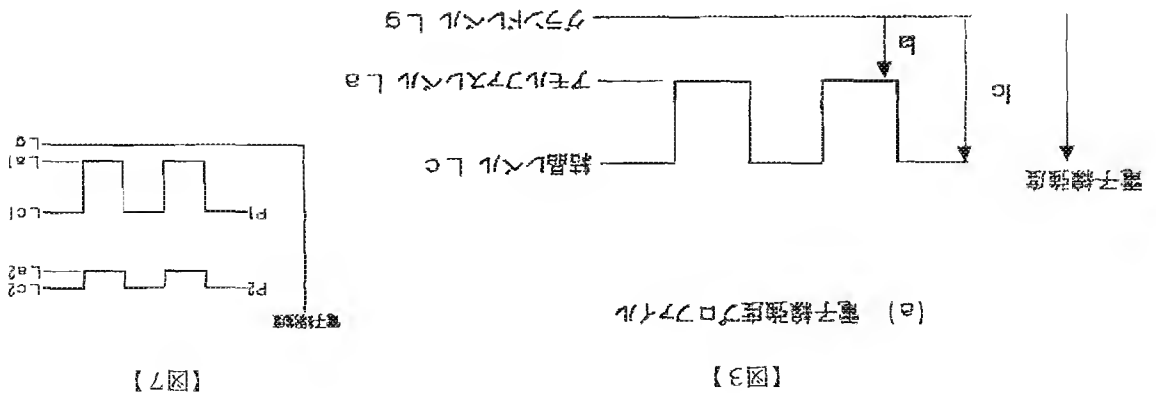
電子線強度プロファイルを示す説明図、(b)はプロフィール形状を示す断面図である。
【図11】そのトラッキング方法を示し、(a)は偏光走査装置の概略構成図、(b)は情報記録媒体の模式的平面図、(c)はトラッキング方法の説明図である。
【符号の説明】
1 情報記録媒体
2 基板
3 導電層
4, 6 誘電体層
5 相変化型記録層
11 情報記録媒体
13 導電層
14 誘電体層
15 相変化型記録層

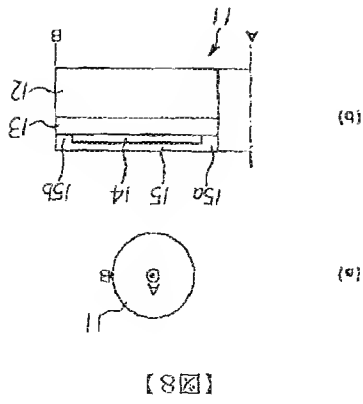
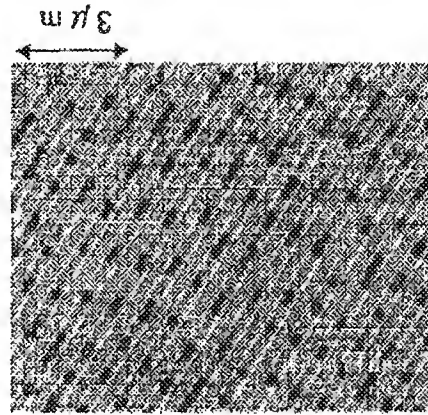
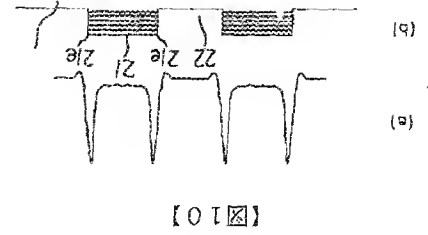
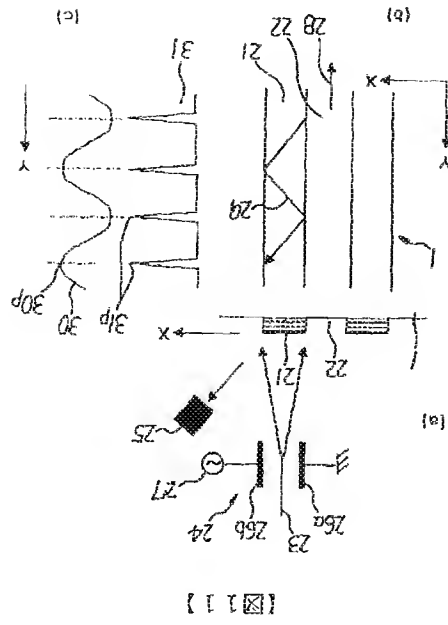


【図4】



(b) 第2誘電体膜厚による変調度の変化





Disclaimer:
This English translation is produced by machine translation and may contain errors. The JPO, the JPPT, and those who drafted this document in the original language are not responsible for the result of the translation.

Notes:
1. Untranslatable words are replaced with asterisks (***).
2. Texts in the figures are not translated and shown as it is.

Translated: 03:58:26 JST 10/15/2011
Dictionary: Last updated 09/09/2011 / Priority: 1. Chemistry / 2. Electronic engineering / 3. Mathematics/Physics

CLAIM + DETAILED DESCRIPTION

[Claim(s)]

[Claim 1] An information recording medium with which recording information is reproduced by presenting hardness change of electron rays between said crystal phase and said amorphous phase when it has on a substrate a phase change type recording layer which causes a phase change between a crystal phase and an amorphous phase at least and electron rays are irradiated to said phase change type recording layer.

[Claim 2] The information recording medium according to claim 1 which has a dielectric layer.

[Claim 3] The information recording medium according to claim 2 in which said dielectric layer is

arranged between said phase change type recording layer and an electron beam source which

irradiates with electron rays, and the thickness is 50 nm or less.

[Claim 4] The information recording medium according to claim 3 with which said dielectric layer is made thinner than thickness at the time of the record at the time of regeneration of the medium

concerned.

[Claim 5] The information recording medium according to any one of claims 1 to 4 which has a

conductive layer.

[Claim 6] The information recording medium according to claim 5 with which said conductive layer

contains at least one kind of element chosen from Ag, Pd, Rh, Ta, W, Au, Pt, Ir, Os, In, Ti, Cu, and Fe group.

[Claim 7] Said phase change type recording layer uses as a principal component an eutectic

presentation in the range of $x/y=1-4$ Sb_x-Te_y Becoming. And the information recording medium

according to any one of claims 1 to 6 which consists of a phase change material containing at least one kind of element chosen from a group of B, aluminum, Si, Ga, germanium, Ag, In, Sn, Ba, La, Au, Bi, and Gd as an alloying element.

[Claim 8] The information recording medium according to any one of claims 1 to 7 which consists of a conductive material in which said substrate has electric resistance in the range of $1 \times 10^{-7} - 100$ ohm-cm.

[Claim 9] The information recording medium according to any one of claims 1 to 8 with which said phase change type recording layer touches said substrate or said conductive layer in electric

conduction at least by a part within a medium side.

[Claim 10] The information recording medium according to any one of claims 1 to 9 used for tracking, an address, or a source of a synchronizing signal of an electron beam source by presenting a steep electron-beam-intensity change by an edge part of said uneven shape when it has the uneven

shape of a constant period in said substrate face and electron rays are irradiated.

[Claim 11] By detecting hardness change of electron rays between said crystal phase presented when it irradiates with electron rays to the information recording medium according to any one of claims 1 to 10 and irradiates with these electron rays, and said amorphous phase] A regeneration method of an information recording medium which reproduced recording information currently

[Claim 12] It glares carrying out the deflection scanning of the electron rays to the information recording medium according to claim 10. A regeneration method of an information recording medium which detects a steep electron-beam-intensity change by an edge part of said uneven shape presented when carrying out the deflection scanning of these electron rays, and was used for tracking, an address, or a source of a synchronizing signal of an electron beam source at the time of regeneration.

[Detailed Description of the Invention]

[0001] [Field of the Invention] This invention relates to an information recording medium in which record of information, elimination, and regeneration are possible, an information recording medium which has a phase change type recording layer especially, and a regeneration method for the same.

[0002] [Description of the Prior Art] There is a rewritten type recording medium which used as the recording layer material which the reversible phase change between amorphous phase-crystal phases produces by light irradiation about the optical recording medium which carries out record regeneration of the information by a laser beam. This medium has the feature which can record new information, eliminating the already recorded information while being able to perform record and elimination.

[0003] Generally, the amorphous state in a recording layer is made into a recorded state, and the crystallized state is changed into the elimination state. A mark is crystallized by annealing, after forming an amorphous mark by quenching after record of information irradiating with the laser beam of a record level and heating more than a melting point, and elimination irradiating with the laser beam of an elimination level and carrying out temperature up to crystallization temperature. Recording information is reproduced by detecting change of the reflected light quantity by the reflectance difference and phase contrast between amorphous phase-crystal phases.

[0004] [Problem to be solved by the invention] In order to raise recording density, reduction of mark length and a track pitch is needed. In the rewritten type or the added type recording medium of a postscrip, record and regeneration are performed by irradiating with the same laser beam. Under the present circumstances, it is recordable by mark length smaller than a beam diameter by shortening the emitted pulse length of a laser beam. However, the mark length who can be reincarnated is decided by the numerical aperture NA of laser emission wavelength and an objective. It opts also for scaling of a track pitch with a beam diameter. This is for mutual interference to happen and for signal strength to decline, when mark length and pitch, or a track pitch becomes below a beam diameter. That is, when the exposure of the same laser beam performs record and regeneration, even if a small mark is recordable, it cannot reproduce, but the regeneration limit will have restricted the recording density of a recording medium. Although the densification by short wavelength laser is advancing as a next generation DVD in an optical disc now, also in which generation, recording density receives reproductive restriction.

[0005] Incidentally, spatial resolving power boils electron rays markedly, and is higher than a laser beam. Therefore, if electron rays can be used for regeneration, reproductive restriction will be eased and it will be thought that recording density can be raised sharply. Actually, this invention persons have reported that a phase change record mark is renewable with electron rays (60th time of 99-year autumn Japan Society of Applied Physics proceedings 3 a-ZC-4 reference). According to JP,H9-7240,A, the memory using electron rays is indicated.

[0006] However, about the information-recording-medium structure which was suitable for

reproducing information using electron rays, reference is not made in detail yet, but when realizing high density recording actually, there is room for examination much.

[0007] Then, an object of this invention is to provide an information recording medium with the medium composition which used electron rays and was suitable for reproducing recording information in order to realize high density recording, and a regeneration method for the same.

[0008] In addition, when reproducing recording information with electron rays, the information recording medium of composition of having excelled in a resistance to environment and reliability is provided.

[0009] The information recording medium which may raise the S/N ratio of a regenerative signal is provided by optimizing the thickness of the dielectric layer arranged to the electron-rays incidence side.

[0010] The information recording medium which loses the damage at the time of record, and may raise the S/N ratio of a regenerative signal is provided by optimizing the disposal method of a dielectric layer located in the electron-rays incidence side.

[0011] The information recording medium which may raise the S/N ratio of a regenerative signal is provided by carrying out the flattening of the medium surface.

[0012] The information recording medium which may raise the S/N ratio of a regenerative signal is provided by optimizing the material of a phase change type recording layer.

[0013] By using a conductive substrate, when reproducing with electron rays, the charge up of the surface which poses a problem is controlled, and the information recording medium which may raise the S/N ratio of a regenerative signal is provided.

[0014] By contacting a phase change type recording layer, a conductive layer, or a conductive substrate, the charge up is controlled and the information recording medium which may raise the S/N ratio of a regenerative signal is provided.

[0015] An information recording medium in which the tracking of the electron beam source which irradiates with electron rays when reproducing is possible, and a regeneration method for the same are provided.

[0016] Means for solving problem] The information recording medium of the invention according to claim 1

has on a substrate a phase change type recording layer which causes a phase change between a crystal phase and an amorphous phase at least, when electron rays are irradiated to said phase change type recording layer, recording information is reproduced by presenting hardness change of electron rays between said crystal phase and said amorphous phase.

[0017] In the phase change record using the usual laser beam, a base is in a crystal phase state and an amorphous phase state has a mark. When it irradiates with electron rays with a scanning electron microscope (SEM) and such an information recording medium is observed, the mark in an amorphous phase state shows a dark contrast variation to the crystal phase of a base. That is, hardness change of electron rays is presented. Therefore, by having medium composition which provided the phase change type recording layer, and irradiating with electron rays when reproducing on a substrate, it becomes possible to reproduce recording information by detecting the intensity difference of electron rays, and the high density recording which does not receive the restrictions by regeneration becomes possible.

[0018] In the invention according to claim 2, the information recording medium according to claim 1 has a dielectric layer. In the invention according to claim 5, the information recording medium

according to any one of claims 1 to 4 has a conductive layer.

[0019] Therefore, when reproducing using electron rays by taking the composition of the information recording medium according to claim 2 or 5, it excels in a resistance to environment and reliability, and becomes a practical information recording medium. That is, in addition to the simple two-layer composition by the substrate and a phase change type recording layer, the information recording medium concerned is constituted including at least one layer among a dielectric layer and

[0020] The invention according to claim 3 is arranged between the electron beam sources which said plurality as a lamination structure, electric layer of the information recording medium according to claim 2 irradiates with said phase change type recording layer and electron rays, and the thickness is 50 nm or less.

[0023] When reproducing by electron beam irradiation, the contrast hardness of a phase change mark becomes the maximum in the state which does not have a dielectric layer in the electron-rays incidence side, i.e., the state where the phase change type recording layer was exposed. However, in order to prevent deterioration of the phase change type recording layer of the time of record this as

[0024] The invention according to claim 6 contains at least one kind of element in which said conductive layer of the information recording medium according to claim 5 is chosen from Ag, Pd, Rh, Ta, W, Au, Pt, Ir, Os, In, Ti, Cu, and Fe group.

[0025] When aiming at improvement in a resistance to environment and reliability, it is preferred that

a conductive layer is included. As a conductive layer in this case, aluminum system alloy materials, such as aluminum-Ti alloy, aluminum-Cr alloy, an aluminum-Hf alloy, and aluminum-Si alloy, can be used. Ag system materials, such as Ag, AgPd, AgCuPd, AgTi, and AgTiCu, Pd and Rh, Ta, W, Au, Pt, Ir, Os, In, Ti, Cu, and Fe can also be used like this invention in the state of a compound with unit matter or other elements. Such materials tend to form a flat face, when it thin-film-izes. Such a conductive layer is arranged to the bottom of the heap, and the flattening also of the outermost surface of an information recording medium can be carried out by considering it as a flat conductive layer. Since surface unevenness serves as a noise component in the case of reproducing with electron rays, its S/N ratio improves by carrying out the flattening of the surface of an information recording medium.

[0026] The invention according to claim 7, [said phase change type recording layer of the information recording medium according to any one of claims 1 to 6] It consists of a phase change material containing at least one kind of element which uses as a principal component the eutectic presentation in the range of $x/y=1-4$ Sb^x-Te^y Becoming, and is chosen from the group of B, aluminum, Si, Ga, germanium, Ag, In, Sn, Ba, La, Au, Bi, and Gd as an alloying element.

[0027] Although the various materials which have been several-kinds-proposed and have so far been put in practical use can be used as a phase change type recording layer, it is preferred to use the recording layer material which uses as a principal component especially the eutectic presentation made into the composition ratio of $x/y=1-4$ in Sb^x-Te^y like this invention. In such a presentation, a clear phase change contrast appears also in a minute mark from the limits of an amorphous mark and a crystal phase field appearing clearly. A mutual reaction with the dielectric layer which the phase change material of such a presentation laminates does not occur easily. Therefore, also in the state where the dielectric layer was removed, a clear phase change contrast is acquired like the invention according to claim 4. Although AgInSbTe is mentioned as a phase change material which uses SbTe of an eutectic presentation as a principal component, A clear phase change mark contrast appears by optimizing a presentation using at least one kind of element chosen from the group of not only a presentation such but B, aluminum, Si, Ga, germanium, Ag, In, Sn, Ba, La, Au, Bi, and Gd.

[0028] The invention according to claim 8 consists of a conductive material in which said substrate of the information recording medium according to any one of claims 1 to 7 has electric resistance in the range of $1 \times 10^{-7} - 100 \text{ ohm-cm}$.

[0029] When reproducing a phase change mark with electron rays, the charge up on the surface of a medium becomes a problem. The charge up as well as surface unevenness serves as a noise component. A substrate is an insulator, and if a phase change type recording layer will be in a floating state, the charge up will occur. The charge up can be reduced by using a conductive substrate as a substrate like this point and this invention. As a conductive substrate, semiconductor materials, such as aluminum alloys, such as aluminum and aluminum-Mg, Si, germanium, and GaAs, can be used. the electric resistance of a substrate -- the range of $1 \times 10^{-7} - 100 \text{ ohm-cm}$ -- the range of $1 \times 10^{-7} - 1 \times 10^{-5} \text{ ohm-cm}$ is preferably good. The value which asked for and converted [substrate thickness Mika] sheet resistance by two terminals or 4 terminal resistance measurement in the opposite side where each layer is laminated, i.e., a substrate rear, may be sufficient as such an electric resistance value.

[0030] The invention according to claim 9 touches in electric conduction at least by the part [recording layer / said / of the Information Storage Division intermediation according to any one of claims 1 to 8 / phase change type] within said substrate or said conductive layer, and a medium side.

[0031] That is, in using an insulating substrate, in using a conductive substrate, it contacts between the metal layer portion of a substrate, and phase change type recording layers between a conductive layer and a phase change type recording layer, contacting parts separated from the

record section — it forms in some media at least. By taking such conduction structure, the charge up can be controlled further.

[0032] The invention according to claim 10, [the information recording medium according to any one of claims 1 to 9] It has the uneven shape of a constant period in said substrate face, and when electron rays are irradiated, it is used for the tracking, the address, or the source of a synchronizing signal of an electron beam source by presenting a steep electron-beam-intensity change by the edge part of said uneven shape.

[0033] That is, a substrate is made into the structure of having periodic uneven shape on the surface with a pre-groove (track guide rail) and constant periods, such as a prepit (concavo-convex hole). Thereby, in the case of record by a laser beam, change of the reflected light intensity by uneven shape is detected, and it is considered as the tracking of a laser beam source, an address, and the source of a synchronizing signal. On the other hand, when reproducing with electron rays, it is considered as the tracking of an electron beam source, an address, and the source of a synchronizing signal by detecting hardness change of electron rays using presenting the steep electron-beam-intensity change by the edge part of uneven shape. When uneven shape is a pre-groove, 10–500 nm of groove depth shall be 30–50 nm preferably, 0.1–10 micrometers of groove pitch shall be 0.3–1 micrometer preferably.

[0034] [the regeneration method of the information recording medium of the invention according to claim 11] The recording information currently recorded on said information recording medium was reproduced by detecting hardness change of the electron rays between said crystal phase presented when it irradiates with electron rays to the information recording medium according to any one of claims 1 to 10 and irradiates with these electron rays, and said amorphous phase. [0035] [therefore the thing reproduced using electron rays using the information recording medium according to any one of claims 1 to 10] Electron rays become renewable [a minute mark], since spatial resolving power is higher than a laser beam, even if they are minute phase change marks which hit a regeneration limit in a laser beam, they can be reproduced, the restrictions by regeneration can be made to be able to ease as a result, and the storage capacity of an information recording medium can be made to increase sharply.

[0036] [the regeneration method of the information recording medium of the invention according to claim 12] It glares carrying out the deflection scanning of the electron rays to the information recording medium according to claim 10, a steep electron-beam-intensity change is detected by the edge part of said uneven shape presented when carrying out the deflection scanning of these electron rays, and it was made to use for the tracking, the address, or the source of a synchronizing signal of an electron beam source at the time of regeneration. [0037] Therefore, the information recording medium according to claim 10 which presents a steep electron-beam-intensity change by the edge part of uneven shape when it has the uneven shape of a constant period in a substrate face and electron rays are irradiated is used, Since a steep electron-beam-intensity change is detected by the edge part of the uneven shape presented when carrying out the deflection scanning of the electron rays and it was made to use for the tracking, the address, or the source of a synchronizing signal of an electron beam source at the time of regeneration, The tracking of electron rays can become possible when reproducing, and reproductive accuracy of position can be raised.

[0038] [Mode for carrying out the invention] A first embodiment of this invention is described based on drawing 1 and drawing 2. The example of lamination of the information recording medium 1 of this embodiment is shown in drawing 1. The information recording medium 1 consists of lamination structure of the 2nd dielectric layer 6 of 5/of the 4/of 1st dielectric layer phase change type recording layers of 3/of substrate 2 / conductive layers in this example. [0039] the substrate 2 — for example, polycarbonate — a substrate — it is considered as the insulating substrate. A pre-groove with a groove depth of 40 nm and a pitch of 0.7 micrometer

exists in the surface of this substrate 2 (not shown), and let substrate thickness be a with 0.6 mm and a substrate diameter of 120 mm disc-like disk. Ag is used as the conductive layer 3 formed on such a substrate 2, and thickness is 120 nm. ZnS.SiO_2 is used as the 1st dielectric layer 4 formed on this conductive layer 3, and thickness is 20 nm. AgInSbTe is used as the phase change type recording layer 5 formed on the 1st dielectric layer 4, and thickness is 15 nm. ZnS.SiO_2 is used as the 2nd dielectric layer 6 formed on five layers of this phase change type recording layer, and thickness is 20 nm. Here, Ag thin film for conductive layer 3 forms membranes by DC sputtering method, and other thin films form membranes by RF sputtering method.

[0040] The electron-rays regeneration result of a record mark is shown in drawing 2. The phase change mark was recorded to the information recording medium 1 of the lamination shown in drawing 1 using the wavelength of 635 nm, and the optical system of numerical aperture NA0.6. Here, duty 50% of the single period mark was recorded, and the mark length of the direction of Than Gen Tal of the information recording medium 1 was changed in 0.1-0.4 micrometer according to conditions. Drawing 2 (a) is a profile of electron beam intensity, and shows the intensity profile of the direction in alignment with the land by which the pre-groove was carried out. Electron beam intensity is strong on a crystal level, and electron beam intensity is weak on the amorphous level. The mark length in the hardness lowered from the electron beam intensity of the crystal level 50% is shown in drawing 2. The laser beam used for record is wavelength [of 635 nm], and numerical aperture NA0.6, and a beam diameter is about 0.9 micrometer ($1/e^2$). When a phase change mark is reproduced by a laser beam, using the same optical system as the time of such record as it is, below the mark length of 0.3 micrometer (mark pitch 0.6micrometer) cannot be reproduced at all by interference between marks. On the other hand, when such an information recording medium 1 is irradiated with electron rays according to an electron beam source and recording information (phase change mark) is reproduced, as shown in drawing 2 (b), it turns out that even the minimum mark length of 0.1 micrometer can be being reproduced.

[0041] That is, in the phase change record using the usual laser beam, a base is in a crystal phase state and an amorphous phase state has a mark. When it irradiates with electron rays with a scanning electron microscope (SEM) and such an information recording medium is observed, the mark in an amorphous phase state shows a dark contrast variation to the crystal phase of a base. That is, hardness change of electron rays is presented. [therefore by having medium composition which formed the phase change type recording layer 5, and irradiating with electron rays when reproducing on the substrate 2,] Since it becomes possible to reproduce recording information by detecting the intensity difference of electron rays and the mark length below the regeneration limit of a laser beam can also fully be reproduced, the high density recording which does not receive the restrictions by regeneration becomes possible.

[0042] A second embodiment of this invention is described based on drawing 3. The same portion as the portion shown by a first embodiment is shown using identical codes, and explanation is also omitted (each subsequent embodiment is also made the same one by one).

[0043] According to this embodiment, the information recording medium 1 of the lamination shown in drawing 1 is used. Drawing 3 shows here the result of having investigated the relation between the thickness of the 2nd dielectric layer 6 on the phase change type recording layer 5, and the contrast hardness of a phase change mark. The thickness of the 2nd dielectric layer 6 by ZnS.SiO_2 is changed in 0-100 nm. In the electron-beam-intensity profile of the phase change mark shown in drawing 3 (a), hardness of 1a and the crystal level 1c is set to 1c for the hardness of amorphous level 1a measured from the grand level 1g of the signal. (1c-1a)/1c defined the modulation degree. A modulation degree changes with the thickness of the 2nd dielectric layer 6 by ZnS.SiO_2 . In the range of 50-100 nm of thickness, the signal from a phase change mark is undetectable. By the thickness of the 2nd dielectric layer 6 being 50 nm or less shows that a phase change mark is renewable using electron rays.

[0044] A third embodiment of this invention is described based on drawing 4. Although the

information recording medium 1 of the lamination shown in drawing 1 is fundamentally used in this

embodiment, the lamination shall differ in the time of record and the regeneration after record. [0045] That is, drawing 4 (a) shows the lamination of the information recording medium 1 at the time of record, and drawing 4 (b) shows the lamination of the information recording medium 1 at the time of regeneration. It changes into the state where there is the 2nd dielectric layer 6 by $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$ in

order to prevent modification of the phase change type recording layer 5 as shown in (the time of record), and drawing 4 (a) when recording by a laser beam. It changes into the state where there is no 2nd dielectric layer 6 by $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$, as [show / on the other hand, / in (the time of regeneration). and drawing 4 (b) / when reproducing with electron rays]. Removal of the 2nd dielectric layer 6 by $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$ is performed by the technique of wet etching. Only $\text{ZnS} \cdot \text{SiO}_2$ can be removed without

giving a damage to AgInSbTe which is the phase change type recording layer 5 by using a fluoric acid solution and a hydrochloric acid solution. As shown in drawing 4 (b), a modulation degree becomes the maximum so that the thickness of the 2nd dielectric layer 6 may be understood by making it thin (here, 0 nm, i.e., a derivative, is removed) also from the characteristics shown in drawing 3, and an S/N ratio becomes large.

[0046] Since in the case of this embodiment the 2nd dielectric layer 6 will be removed once it is recorded, it is not suitable for a rewritten type, but when observing the mark formation recorded by the laser beam in the manufacturing process of an information recording medium, it can apply.

[0047] A fourth embodiment of this invention is described based on drawing 5. According to this embodiment, the information recording medium 1 of the lamination shown in drawing 1 is used. [0048] Drawing 5 shows the SEM image which observed the phase change mark of such an information recording medium 1 with the scanning electron microscope. In such a SEM image,

surface periodic unevenness is the pre-groove formed in the substrate 2, and a contrast variation is seen along with a land. Therefore, if a base is a crystallized state, a mark is an amorphous state and SEM observation of such an information recording medium 1 is fundamentally carried out by the usual phase change record. Since an amorphous mark shows a dark contrast variation to the crystal of a base, it can be said by detecting the intensity difference of electron rays that it is possible to reproduce recording information by having medium composition which formed the phase change type recording layer 5 on the substrate 2.

[0049] When the conductive layer 3 is set to AlTi, drawing 5 (a) makes the SEM image at the time of carrying out the conductive layer 3 as the embodiment of ** a first with Ag contrast, and shows drawing 5 (b) here. In any case, the thickness of the conductive layer 3 is 120 nm. Surface

unevenness is emphasized in the medium which made the conductive layer 3 AlTi material, and a phase change contrast is indistinct. On the other hand, in the medium which made the conductive layer 3 Ag material, the flattening of the surface of the information recording medium 1 can be carried out, and the contrast hardness of a phase change mark is increasing. If the sample

(information recording medium 1) surface is irradiated with electron rays, a secondary electron and a reflection electron will be emitted. Especially the hardness of a secondary electron changes with the shape of a surface type sensitively. If unevenness exists in the surface when reproducing a phase change mark, the signal from unevenness of a base will be a noise component, and the signal from a phase change mark will be buried. Therefore, the contrast variation accompanying a phase change can detect now clearly by carrying out the flattening of the medium surface by making the

[0050] A fifth embodiment of this invention is described based on drawing 6 and drawing 7. Especially this embodiment is related with the material of the substrate 2. drawing 6 (a) — as the substrate 2a — polycarbonate — a substrate — the example using an insulating substrate is shown — drawing 6 (b) — as substrate 2b — an Al substrate — the example using a conductive substrate is shown.

Each thickness of the substrate 2a and 2b is 0.6 mm, and, as for 5×10^{-6} omega-cm and a

polycarbonate board, the Al substrate of resistibility is an insulator. Each made the phase change type recording layer 5 30 nm of thickness by AgInSbTe. 7 shows the phase change mark portion. [0051] Drawing 7 is an electron-beam-intensity profile of the phase change mark reproduced using electron rays about these information recording media. P1 is a profile in the medium using substrate 2b by an Al substrate, and, as for Lg, amorphous level and Lc1 is the signal strength of a crystal level grand level and Lat. P2 is a profile in the medium using the substrate 2a by a polycarbonate board, Lat is an amorphous level and Lc2 is the signal strength of a crystal level. The modulation degree of the phase change mark 7 is $80\% = [(Lc1 - Lat) / Lc1]$ by the medium using substrate 2b according to an Al substrate to being $10\% = [(Lc2 - Lat) / Lc2]$ by the medium using the substrate 2a by a polycarbonate board. When a phase change mark is reproduced with electron rays and it is based on an insulating polycarbonate board, the surface of the phase change type recording layer 5 is charged. For this reason, a regenerative signal will be taken by fixed bias and a modulation degree will fall. By using a conductive substrate like this point and an Al substrate, electrification of the surface of the phase change type recording layer 5 can be missed to substrate 2b, and an S/N ratio becomes large.

[0052] A sixth embodiment of this invention is described based on drawing 8 and drawing 9. This embodiment is related with the composition which can control the charge up, when an insulating substrate like a polycarbonate board is used as the substrate 12, and reproducing using electron rays.

[0053] Drawing 8 (a) shows the top view of the information recording medium 11 of this embodiment. About the disk-like information recording medium 11, A shows a disk center and B shows the outermost periphery. Drawing 8 (b) shows the A-B line section structure of such an information recording medium 11. On the substrate 12 by a polycarbonate board, the conductive layer 13 by Ag thin film is formed, the dielectric layer 14 by $ZnS.SiO_2$ is formed on this conductive layer 13, and the phase change type recording layer 15 by AgInSbTe is formed on this dielectric layer 14. The structure which this phase change type recording layer 15 contacts directly at the conductive layer 13 in the most-inner-circumference portion 15a and the outermost periphery portion 15b by the side of the disk center A which avoided the record section of the information recording medium 11, and flows is taken here.

[0054] Thereby, as well as the case of a fifth embodiment using a conductive Al substrate when a phase change mark is reproduced with electron rays, even if the surface of the phase change type recording layer 5 is charged, it can miss to the conductive layer 13 which has flowed through the electrification charge, and an S/N ratio becomes large.

[0055] Drawing 9 is a top view showing the manufacturing method of the information recording medium 11 which takes such partial contact structure. 11 is the information recording medium mentioned above. 16 and 17 are sputtering processes and are the inner circumference holder and periphery holder holding the information recording medium 11. In the lamination shown in drawing 8 (b), the size of the holders 16 and 17 for membrane formation of the dielectric layer 14 by $ZnS.SiO_2$ is changed with the case of the holder for membrane formation of other thin films. Outside diameter Ra of the inner circumference holder 16 is made larger than others, and the inside diameter Rb of the periphery holder 17 is made small. It can be considered as the lamination which the mask of a most-inner-circumference portion and the outermost periphery portion is carried out [lamination]. makes the portion laminate the most-inner-circumference portion 15a and the outermost periphery portion 15b of the phase change type recording layer 15 at the time of membrane formation of the dielectric layer 14 by $ZnS.SiO_2$, and carries out conduction to the conductive layer 13 with such a method for film deposition.

[0056] A seventh embodiment of this invention is described based on drawing 5, drawing 10, and drawing 11. This embodiment is related with the tracking of the electron beam source in the regeneration operation using electron rays, etc.

[0057]According to this embodiment, as shown in the SEM image of drawing 5, it is based on providing the pre-groove which makes the uneven shape of a constant period to the substrate 2 of the information recording medium 1. The direction which crosses the pre-groove in the SEM image shown in drawing 5 (b) in drawing 10 (a) (the direction which crosses a track = the electron-beam intensity profile of the section of a disk radial direction is shown.) Drawing 10 (b) shows the sectional shape of the pre-groove on the surface of a medium, 21 shows a land part and 22 shows the groove portion.

[0058]The electron beam intensity of a land groove face turns into constant intensity mostly so that the SEM image shown in drawing 5 may also show, but electron beam intensity increases extremely by the edge part 21e of the land 21. This is based on the edge effect of a secondary electron. According to this embodiment, the steep increase in the electron beam intensity in the edge part 21e of the land 21 of such uneven shape is used for the tracking, the address, or the source of a synchronizing signal of an electron beam source (not shown) for irradiating with electron rays. [0059]The tracking method of an electron beam source is explained with reference to drawing 11. Drawing 11 (a) shows the scanning method of the electron rays to the information recording medium 1. 23 shows the locus of electron rays. 24 is a deflecting scanner of electron rays. 25 is an electron-rays detecting element. The deflecting scanner 24 carries out the deflection scanning of the electron rays to one axial direction (the direction of X), when it comprises the counter electrodes 26a and 26b and the signal source 26, and the electrode 26b of a grand level and another side is connected to the signal source 27 and one electrode 26a impresses an alternating current signal to the signal source 27.

[0060]Drawing 11 (b) is a top view of the information recording medium 1. It corresponds to the rugged form sectional shape shown in drawing 11 (a), and 22 is a groove and 21 is a land. 28 shows the direction of rotation of the information recording medium 1, and 29 shows the locus of the electron rays on the land 21. Electron rays draw the locus 29 by making the direction of rotation 27 rotate the information recording medium 1, making the deflection scanning of the electron rays carry out in the direction of X with the deflecting scanner 24.

[0061]Drawing 11 (c) is an explanatory view of a tracking method. 30 is an input signal over the signal source 27 of the deflecting scanner 24. 31 is the detection signal detected with the electron-rays detecting element 25. Since signal strength increases steeply by the edge part 21e of the land 21 as shown in drawing 10, the detection signal 31 serves as a profile which has a peak periodically. Therefore, whenever it has carried out the tracking of the electron rays correctly on the land 21 like drawing 11 (b), the peak 31p of the detection signal 31 detected and the peak 30p of an alternating current signal are in agreement. Therefore, a deflecting scanner (the tracking to the land 21 top of electron rays becomes possible by controlling the voltage of the input signal of 24, and a frequency, and applying a servo so that the peak of the alternating current signal 30 and the detection signal 31 may be in agreement.) [0062]

[Effect of the Invention]According to the information recording medium of the invention according to claim 1, it has on a substrate a phase change type recording layer which causes a phase change between a crystal phase and an amorphous phase at least. Since it had composition by which recording information is reproduced by presenting hardness change of electron rays between said crystal phase and said amorphous phase when electron rays were irradiated to said phase change type recording layer, it becomes possible to reproduce recording information by detecting the intensity difference of electron rays by irradiating with electron rays when reproducing, and in a laser beam, it can reproduce, even if it is a minute phase change mark which hits a regeneration limit, and therefore, high density recording which does not receive the restrictions by regeneration can be made possible. [0063]Since the information recording medium according to claim 1 has a dielectric layer, and the information recording medium according to any one of claims 1 to 4 has a conductive layer

according to the invention according to claim 2 according to the invention according to claim 5. When reproducing using electron rays, it excels in a resistance to environment and reliability, depends, and becomes a practical information recording medium.

[0064] In [according to the invention according to claim 3] the information recording medium according to claim 2, Since deterioration of the phase change type recording layer under the heat damage by the laser beam exposure at the time of record or storage environment can be prevented by having a dielectric layer and the thickness is 50 nm or less, the regeneration operation using electron rays is not spoiled.

[0065] According to the invention according to claim 4, [said dielectric layer of the information recording medium according to claim 3] The S/N ratio of the regenerative signal in the regeneration operation using electron rays can be raised avoiding deterioration of the phase change type recording layer under the laser beam *** heat damage at the time of record or storage environment, since it is made thinner than the thickness at the time of the record at the time of regeneration of the medium concerned.

[0066] Since the conductive layer of the information recording medium according to claim 5 contains at least one kind of element chosen from Ag, Pd, Rh, Ta, W, Au, Pt, Ir, Os, In, Ti, Cu, and Fe group according to the invention according to claim 6, When it thin-film-izes, it can be easy to form a flat face, and such a conductive layer can be arranged to the bottom of the heap, and improvement in a resistance to environment and reliability — can carry out the flattening also of the outermost surface of an information recording medium by considering it as a flat conductive layer, and therefore an S/N ratio improves — can be aimed at.

[0067] According to the invention according to claim 7, [the phase change type recording layer of the information recording medium according to any one of claims 1 to 6] The eutectic presentation in the range of $x/y=1-4 \text{ Sb}^x\text{-Te}^y$ Becoming is used as a principal component, And since it consists of a phase change material containing at least one kind of element chosen from the group of B, aluminum, Si, Ga, germanium, Ag, In, Sn, Ba, La, Au, Bi, and Gd as an alloying element, From the limits of an amorphous phase mark and a crystal phase field appearing clearly, a clear phase change contrast appears also in a minute mark, and also [the phase change material of such a presentation] Since a mutual reaction with the dielectric layer to laminate does not occur easily, also in the state where the dielectric layer was removed, a clear phase change contrast can be acquired like the invention according to claim 4.

[0068] According to the invention according to claim 8, [the substrate of the information recording medium according to any one of claims 1 to 7] Since electric resistance consists of a conductive material in the range of $1 \times 10^{-7} - 100 \text{ ohm-cm}$, when reproducing a phase change mark with electron rays, the charge up on the surface of a medium which poses a problem can be reduced by this conductive substrate.

[0069] According to the invention according to claim 9, [the information recording medium according to any one of claims 1 to 8] Since it is contacting between the metal layer portion of a substrate, and phase change type recording layers in using an insulating substrate, and using a conductive substrate between a conductive layer and a phase change type recording layer, the charge up can be controlled further.

[0070] According to the invention according to claim 10, [the information recording medium according to any one of claims 1 to 9] Since it was made to be used for the tracking, the address, or the source of a synchronizing signal of an electron beam source by presenting a steep electron-beam-intensity change by the edge part of uneven shape when it had the uneven shape of a constant period in a substrate face and electron rays were irradiated, When reproducing with electron rays, it can be considered as the tracking of an electron beam source, an address, and the source of a synchronizing signal by detecting hardness change of electron rays using presenting the steep electron-beam-intensity change by the edge part of uneven shape.

[0071] According to the regeneration method of the information recording medium of the invention

according to claim 11, [using the information recording medium according to any one of claims 1 to 10] [reproducing using electron rays] Electron rays become renewable [a minute mark], since spatial resolving power is higher than a laser beam, even if they are minute phase change marks which hit a regeneration limit in a laser beam, they can be reproduced, the restrictions by regeneration can be made to ease as a result, and the storage capacity of an information recording medium can be made to increase sharply.

[0072]According to the regeneration method of the information recording medium of the invention according to claim 12, it has the uneven shape of a constant period in a substrate face. The information recording medium according to claim 10 which presents a steep electron-beam-intensity change by the edge part of uneven shape when electron rays are irradiated is used. Since a steep electron-beam-intensity change is detected by the edge part of the uneven shape presented when carrying out the deflection scanning of the electron rays and it was made to use for the tracking, the address, or the source of a synchronizing signal of an electron beam source at the time of regeneration, The tracking of electron rays can become possible when reproducing, and reproductive accuracy of position can be raised.

[Translation done.]